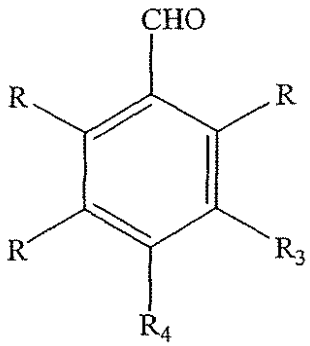
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成17年7月7日(2005.7.7)

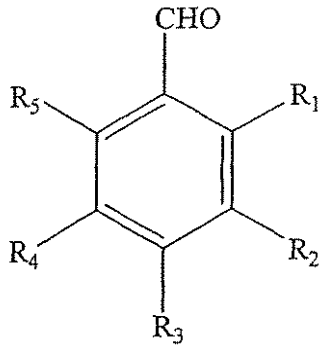
【公表番号】特表2004-533423(P2004-533423A)
【公表日】平成16年11月4日(2004.11.4)
【年通号数】公開・登録公報2004-043
【出願番号】特願2002-576540(P2002-576540)
【国際特許分類第７版】
　Ｃ０７Ｄ 493/04
　Ｃ０８Ｋ　5/1575
　Ｃ０８Ｌ 23/00
// Ａ６１Ｋ　7/32
【ＦＩ】
　Ｃ０７Ｄ 493/04　１０６Ｂ
　Ｃ０８Ｋ　5/1575
　Ｃ０８Ｌ 23/00
　Ａ６１Ｋ　7/32

【手続補正書】
【提出日】平成15年11月18日(2003.11.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも1 mol のアルジトールと式（I）及び式（II）：
【化１】
(I)



［式中、R は、独立して、水素、1～4個の炭素原子を有する低級アルキル基、低級アルコキシル基及びハロゲンから選ばれ；
R_3 及び R_4 は、1～4個の炭素原子を有する低級アルキル基、低級アルコキシル基、塩素、臭素、ヨウ素及びフッ素から選ばれ；
ただし、R_3 及び R_4 の1つのみが、塩素、臭素及びヨウ素からなる群から選ばれる。］

【化２】
(II)

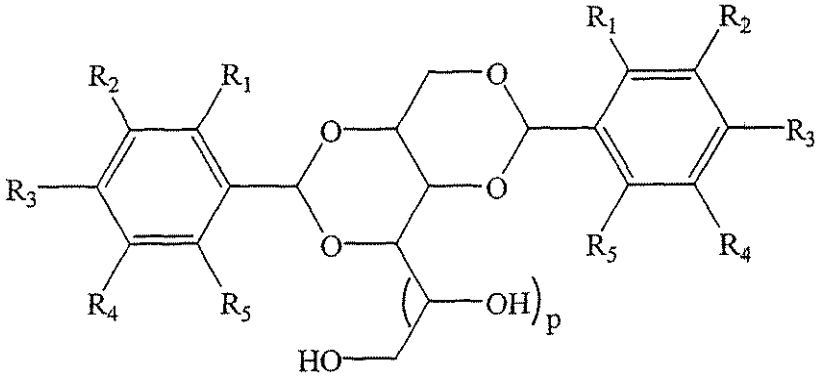


［式中、R_1、R_2、R_3、R_4 及び R_5 は、独立して、水素、3～6個の炭素原子を有するアルキル基、1～6個の炭素原子を有するアルコキシル基及びフェニルからなる群から選ばれ、またはいずれか2つの隣接基は環状基を形成するように組み合わせられ得、前記環状基は、メチレンジオキシ、シクロペンチル及びシクロヘキシルからなる群から選ばれ；
ただし、R_1、R_2、R_3、R_4 及び R_5 の少なくとも1つの基は、水素以外の基である。］
のいずれかに従う化合物から選ばれる少なくとも1 mol のアリールアルデヒドとの反応生成物である化合物。

【請求項２】
前記反応生成物がジアセタールであり、前記アルジトールがソルビトールである請求項１に記載の化合物。

【請求項３】
式（III）：

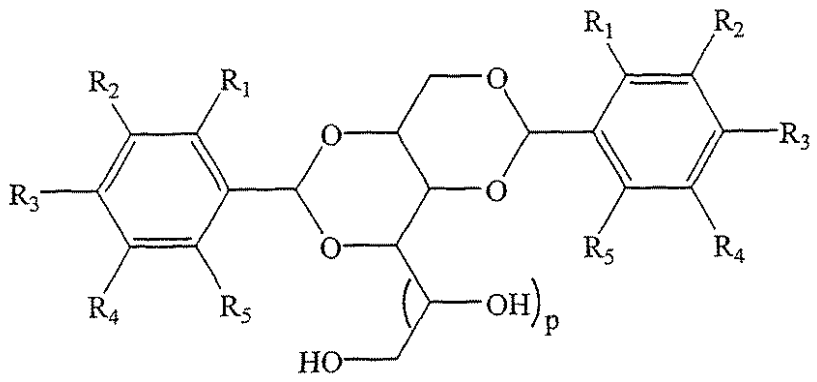
【化３】
(III)



［式中、p は、0、1または2であり；
R は、独立して、水素、1～4個の炭素原子を有する低級アルキル基、低級アルコキシル基及びハロゲンから選ばれ；
R_1、R_2、R_3 及び R_4 は、1～4個の炭素原子を有する低級アルキル基、低級アルコキシル基、塩素、臭素、ヨウ素及びフッ素から選ばれ；
ただし、R_1 及び R_2 の1つのみが塩素、臭素及びヨウ素から選ばれ、R_3 及び R_4 の1つのみが R_1 または R_2 と同じ塩素、臭素またはヨウ素であって、化合物全体は対称である。］
の構造に従う化合物。

【請求項４】
式（IV）：

【化４】
(IV)



［式中、ｐ は、0、1または2であり；
R_1、R_2、R_3、R_4 及び R_5 は、独立して、水素、3～6個の炭素原子を有するアルキル基、1～6個の炭素原子を有するアルコキシル基からなる群から選ばれ、またはいずれか2つの隣接基はメチレンジオキシを形成するように組み合わせられ得；
ただし、R_1、R_2、R_3、R_4 及び R_5 の少なくとも1つの基は、水素以外の基である。］
の構造に従う化合物。

【請求項５】
前記ジアセタールが、ビス(4-クロロ-3-メチルベンジリデン)ソルビトール；ビス(3-クロロ-4-メチルベンジリデン)ソルビトール；ビス(4-クロロ-2,3-ジメチルベンジリデン)ソルビトール；ビス(3-クロロ-2,4-ジメチルベンジリデン)ソルビトール；ビス(3-クロロ-4-メトキシ-ベンジリデン)ソルビトール；及びビス(2,4-ジクロロ-3-メチルベンジリデン)ソルビトール；ビス(3-ブロモ-4-メチルベンジリデン)ソルビトール；ビス(3-ブロモ-4-エチルベンジリデン)ソルビトール；ビス(3-ブロモ-4-イソプロピルベンジリデン)ソルビトール；ビス(4-ブロモ-3-メチルベンジリデン)ソルビトール；ビス(3-ヨード-4-メチルベンジリデン)ソルビトール；及びビス(4-ヨード-3-メチルベンジリデン)ソルビトール、ビス(4-t-ブチルベンジリデン)ソルビトール並びにビス(3,4-メチレンジオキシベンジリデン)ソルビトールからなる群から選ばれる請求項３に記載の化合物。

【請求項６】
請求項３～５のいずれかに記載の化合物を含むポリオレフィン組成物。

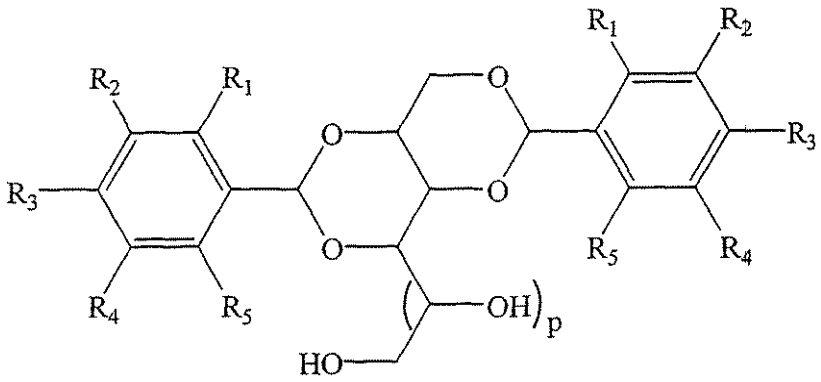
【請求項７】
脂肪族モノオレフィンのホモポリマーの少なくとも1つまたは脂肪族モノオレフィン及び1つ以上のエチレン性不飽和脂肪族コモノマーを含むコポリマー、及び請求項３に記載の化合物の少なくとも1つのジアセタールを含んでなる、改善された透明性を有するポリオレフィンプラスチック組成物であって、前記モノオレフィンは2～6個の炭素原子を有し、前記ホモポリマーまたはコポリマーの平均分子量が約10,000～約500,000であり、前記コポリマーは前記モノオレフィンと前記コモノマーとの重合によって生成される、ポリオレフィンプラスチック組成物。

【請求項８】
前記ジアセタールが、前記ポリオレフィン組成物中、組成物の総重量に基づいて約0.01～約2重量％の量で存在する請求項７に記載の組成物。

【請求項９】
脂肪族モノオレフィンが、エチレン、プロピレン、1-ブテン、ビニルシクロヘキサン及びメチルペンテンからなる群から選ばれる請求項７に記載の組成物。

【請求項１０】
請求項１に記載の少なくとも1つの化合物と請求項１に記載の化合物以外の透明剤の物理的混合物。

【請求項１１】
前記その他の透明剤がジベンジリデンソルビトール誘導体である、請求項１０に記載の物理的混合物。
【請求項１２】
前記ジベンジリデンソルビトールがビス(3,4-ベンジリデン)ソルビトールである、請求項１１に記載の物理的混合物。
【請求項１３】
請求項３に記載の少なくとも1つの化合物と請求項３に記載の化合物以外の透明剤の物理的混合物。
【請求項１４】
前記その他の透明剤がジベンジリデンソルビトール誘導体である、請求項１３に記載の物理的混合物。
【請求項１５】
前記ジベンジリデンソルビトールがビス(3,4-ベンジリデン)ソルビトールである、請求項１４に記載の物理的混合物。
【請求項１６】
少なくとも1つの置換ベンジリデン成分を含むベンジリデンアルジトールアセタールであって、前記少なくとも1つの置換ベンジリデン成分が、3- または 4- 位に1つのハロゲンペンダント基を、3- または 4- 位に低級アルキル基及び低級アルコキシル基からなる群から選ばれるもう1つのペンダント基を少なくとも有する、ベンジリデンアルジトールアセタール。
【請求項１７】
（a）アルジトール（例えばソルビトール、キシリトール及びリビトール）の少なくとも1つのジアセタール及びその混合物から選ばれたゲル化剤約0.25%～約10%；
［前記アルジトールのジアセタールは構造式（III）：
【化５】
(III)



（式中、p は、0、1または2であり；
R は、独立して、水素、1～4個の炭素原子を有する低級アルキル基、低級アルコキシル基、塩素、臭素、ヨウ素及びフッ素からなる群から選ばれ；
R_1、R_2、R_3 及び R_4 は、独立して、1～4個の炭素原子を有する低級アルキル基、低級アルコキシル基及び塩素からなる群から選ばれ；
ただし、R_1 及び R_2 の1つのみが塩素、臭素及びヨウ素から選ばれ、R_3 及び R_4 の1つのみが R_1 または R_2 と同じ塩素、臭素またはヨウ素であって、化合物全体は対称である。）
を有する。］及び
（b）前記ゲル化剤のための溶媒約10%～約98%
を含む固体ゲル化組成物。
【請求項１８】

溶媒が、一価アルコール、多価アルコール、プロピレンカーボネート、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、DMSO、DMF、NMP、水及びそれらの混合物からなる群から選ばれる、請求項１９に記載の固体ゲル。

【請求項１９】

溶媒が、プロピレンカーボネート、メタノール、エタノール、n-プロパノール、n-ブタノール、2-メトキシエタノール、2-エトキシエタノール、エチレングリコール、1,2-プロピレングリコール、1,3-プロピレングリコール、1,4-ブチレングリコール、1,2-ブチレングリコール、ジエチレングリコール、イソプロパノール、イソブタノール、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、1,3-ブチレングリコール、2,3-ブチレングリコール、ジプロピレングリコール、2,4-ジヒドロキシ-2-メチルペンタン及びそれらの混合物からなる群から選ばれる、請求項１７に記載の固体ゲル。

【請求項２０】

溶媒が、芳香族化合物、ハロゲン化芳香族化合物、硝酸化芳香族化合物、ケトン、アミン、ニトリル、エステル、アルデヒド及びそれらの混合物から選ばれる、請求項１８に記載の固体ゲル。